

纳米压印模具

1 用于热纳米压印的镍模具

运用光盘制造技术生产

- 先进的光刻技术：适用于高精度形状、大型尺寸...
- 采用无电解电镀工艺，实现了超细微图案的转印

制造工艺

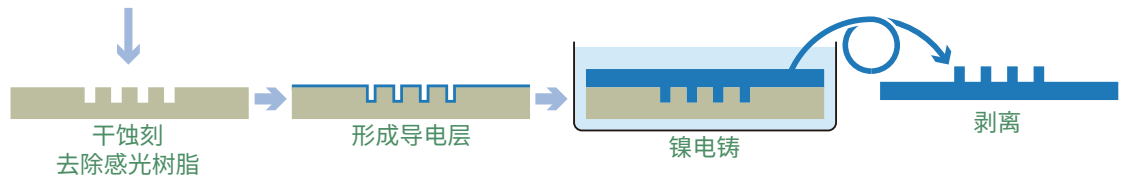
(i) 高精度A型：

电子束感光树脂原版

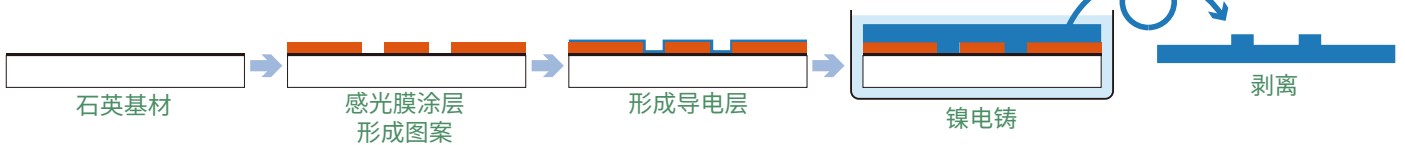


(ii) 高精度B型：

硅蚀刻原版



(iii) 大型



图案样品

高精度 A 型
(高度：~ 300nm)



高精度 B 型
(六角柱形状、宽度及高度：1μm)



大型
(高度：~ 1μm)



短边宽度 20μm (400×280mm 区域)

线宽及间隔 (2μm / 1μm)

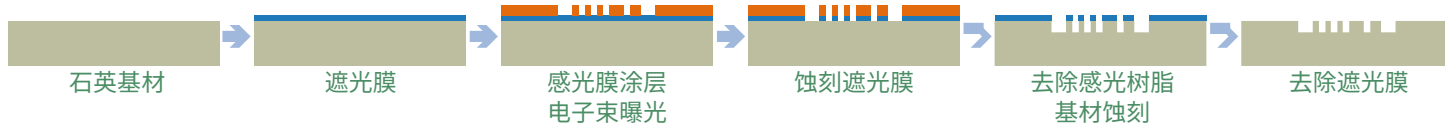
2 用于 UV 纳米压印的石英模具

运用光掩模的石英基板和制造装置生产

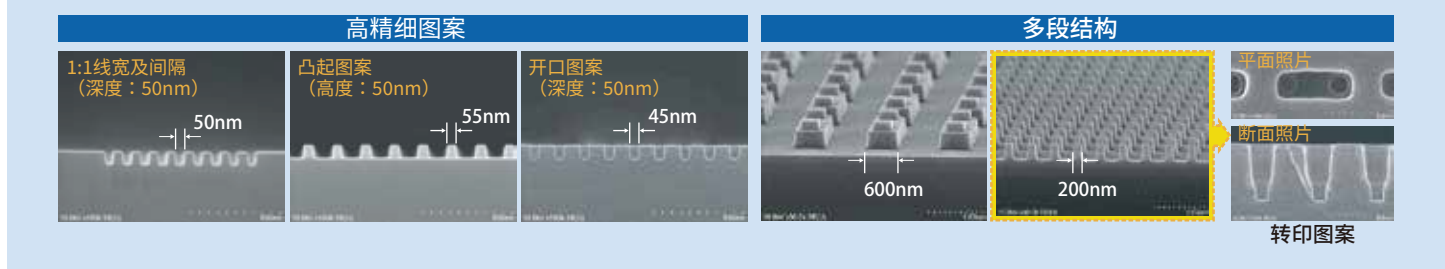
— 最大模具尺寸：6英寸□

可以方便地形成高精细形状

制造工艺



图形样品



3 用于热纳米压印的硅模具

运用模板掩模制造技术生产

— 最大模具尺寸：直径 200mm

可实现高纵横比的形状

制造工艺



图形样品

